

COMPOL

Exotic
Material Polish



この写真はイメージです。This photograph is an image.

COMPOL

COMPOLは、LiTaO₃、LiNbO₃、サファイア等の電子材料基盤、金属材料及びセラミックスのポリッシング専用に開発された高純度コロイダルシリカスラリーです。粒子の均一性、分散性に優れ、高能率でダメージフリーの研磨面が得られます。

COMPOL

COMPOL is a colloidal silica slurry developed especially for polishing metals, ceramics and electronic substrates such as LiTaO₃, LiNbO₃ and sapphire. With excellent particle uniformity and dispersal, it delivers high-removal rate, damage free polishing. Even when used at high dilutions, COMPOL delivers excellent processing efficiency and long slurry life.

COMPOLの代表的物性 Typical Physical Properties of COMPOL

項目 Item	製品名 Type	20	50	80	120
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		40	40	40	40
PH		9.2	10.2	10.2	9.2
比重 Specific gravity		1.30	1.30	1.30	1.30
平均粒子径 Average particle size (nm)		15.0	40.0	72.0	82.5
標準入数 Standard Net weight		20kg	20kg	20kg, 260kg	20kg

用途:サファイア、CaF₂、BGO、LiTaO₃、LiNbO₃その他の酸化物結晶
applications:sapphire, CaF₂, BGO, LiTaO₃, LiNbO₃ and other oxide crystals

項目 Item	製品名 Type	EX-3	403
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		50	46
PH		9.5	9.3
比重 Specific gravity		1.385	1.340
平均粒子径 Average particle size (nm)		32.5	39.0
標準入数 Standard Net weight		20kg	20kg

用途:サファイア、CaF₂、BGO、LiTaO₃、LiNbO₃その他の酸化物結晶
applications:sapphire, CaF₂, BGO, LiTaO₃, LiNbO₃ and other oxide crystals